BL-16A/2019G622, 2016S2-005

マルチフェロイック Fe₂Mo₃O₈ 薄膜の X 線磁気円二色性 X-ray magnetic circular dichroism study of multiferroic Fe₂Mo₃O₈ thin films

芝田悟朗^{1*},毛司辰²,池田啓祐³,和達大樹⁴,齋藤智彦¹,片山司², 長谷川哲也²,藤森淳⁵

1東京理科大学理学部第一部 応用物理学科 〒125-8585 東京都葛飾区新宿 6-3-1

2東京大学大学院理学系研究科化学専攻,〒113-0033東京都文京区本郷7-3-1

3東京大学物性研究所極限コヒーレント光科学研究センター,

〒277-8581 千葉県柏市柏の葉 5-1-5

4兵庫県立大学大学院理学研究科物質科学専攻,〒678-1297兵庫県赤穂郡上郡町光都 3-2-1

5早稲田大学先進理工学部応用物理学科,〒169-8555東京都新宿区大久保 3-4-1

Goro SHIBATA^{1,*}, Shishin MO², Keisuke IKEDA³, Hiroki WADATI⁴, Tomohiko SAITOH¹, Tsukasa KATAYAMA², Tetsuya HASEGAWA², and Atsushi FUJIMORI⁵

¹Department of Applied Physics, Faculty of Science Division I, Tokyo University of Science, 6-3-1 Niijuku, Katsushika-ku, Tokyo 125-8585, Japan

²Department of Chemistry, Faculty of Science, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan

³Laser and Synchrotron Research Center, The Institute for Solid State Physics, 5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8581, Japan

⁴Department of Material Science, School of Science, Hyogo University, 3-2-1 Koto, Kamigori, Hyogo 678-1297, Japan

⁵Department of Applied Physics, School of Advanced Science and Engineering, Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8555, Japan

1 <u>はじめ</u>に

マルチフェロイック物質は 2 つ以上の秩序特性を 併せ持つ物質群であり、電場による磁化制御、磁場 による分極制御への応用の観点から注目を集めてい る。近年、層状の結晶構造をもつ物質である Fe2Mo3O8 (FMO)が強誘電性と反強磁性を併せ持つマ ルチフェロ物質であり、実際に電気磁気効果を示す ことが明らかになった[1,2]。この物質は基底状態と しては層間の磁気モーメントが打ち消し合う反強磁 性であるが、数テスラ程度の強磁場印加[1,2]や元素 置換[2]による磁気相互作用の変化によってフェリ磁 性相が安定化することが知られている。より具体的 には、結晶中に1:1の割合で存在する正四面体(T_d)Fe サイトと正八面体(O_h)Feサイトが異なる大きさの磁 気モーメントを持ち、それらが互いに逆向きのスピ ンを持つことでフェリ磁性となる[1-3]。このように、 バルク Fe2Mo3O8は反強磁性相とフェリ磁性相の相境 界付近にあると考えられる。そのため、室温に近い 条件で強磁場を用いることなくより安定的にマクロ な磁化を持つフェリ磁性相を安定化させることがで きれば、応用の幅が大きく広がることが期待される。

最近、Al₂O₃ 基板上に成長させた FMO 薄膜がフェ リ磁性を示し、さらに磁気転移温度がバルクの場合 の 60 K から大幅に上昇して 230K となることが明ら かとなった[4]。この転移温度の上昇の起源について は、薄膜とバルクとの間における構造の差(エピタ キシャル歪み、欠陥、antisite など)や化学組成の違 いに由来すると考えられるが、その具体的機構は未 だ不明である。仮にこの微視的機構が明らかになれ ば、磁気転移温度をさらに上昇させるための指針が 得られることが期待される。

本研究では、FMO 薄膜における Fe の電子状態、 特に *T_d*, *O_h*の各サイトの Fe が示す磁性と電子状態に ついて明らかにするため、Al₂O₃ 基板上 FMO 薄膜の X 線磁気円二色性 (XMCD) 測定を行った。

2 <u>実験</u>

Pulsed Laser Deposition (PLD) 法により、c 軸配向 Al₂O₃基板上に膜厚約 80 nm の FMO 薄膜試料を成長 させた。蒸着は 10⁻² Torr の Ar 雰囲気下で行い、蒸着



温度は 780℃であった。作製した薄膜はフェリ磁性 転移温度 230 K を示し、100 K において飽和磁化 1.5 $\mu_{\rm B}$ /f.u., 保磁力 20 kOe の磁気ヒステリシス曲線を 示した[4]。XMCD 測定は KEK-PF の BL-16A に設置 したベクトルマグネット XMCD 装置[5,6]を用いて行 った。図 1 に本実験の測定配置を示す。以前の研究 と同様に、面直磁場配置かつ入射角 45°の配置で測 定を行った[7]。測定温度は T = 100 K であった。測 定時の真空度は約 1×10⁻⁹ Torr であった。

3 結果および考察

図 2 に、T=100 K で測定した Al₂O₃ 基板上 FMO 薄膜の X 線吸収分光 (XAS) および XMCD スペクトル を示す。XAS スペクトルの形状は FeO のもの[8]と類 似しており、主成分が Fe²⁺であることが分かる。 FMO の各イオンの形式価数はFe²⁺Mo₃⁴⁺O₈²⁻であり、 本結果はそれと合致している。また、XMCD スペク トルの形状および強度は磁場に依存していないこと が分かる。このことから、常磁性成分はほとんど存 在せず、強磁性(フェリ磁性)成分が主な磁性を担 っていることが分かる。磁場 1 T のスペクトルに対 し XMCD 総和則[9,10]を適用した結果、軌道磁気モ ーメント M_{orb} と有効スピン磁気モーメント M_{spin}^{eff} の比 は M_{orb}/M_{spin}^{eff} ~0.3となった。この比は 3d 遷移金属元 素としては比較的大きな値であり、本薄膜が示す垂 直磁気異方性と関係している可能性がある。

図3は、磁場1TのXMCDスペクトルを複数の参照スペクトル[11-13]と比較したものである。ピーク 位置および符号の比較から、本実験で測定したFMO 薄膜は O_h 対称性を持つFeイオンが磁場と反平行、 T_d 対称性を持つFeイオンが磁場と平行に磁化してい るようなフェリ磁性体であることが明らかになった。



図 2: *T*=100 K における Al₂O₃ 基板上 FMO 薄膜の(a)XAS, (b)XMCD スペクトル

バルク FMO のメスバウアー測定によれば、 O_h 対称 Fe サイトの方が T_d 対称 Fe サイトよりも大きなスピン磁気モーメントを持っていることが知られており [3]、本実験結果は薄膜での磁気構造がバルクのもの とは異なっている可能性があることを示唆するもの になっている。例えば、異なる T_d 対称 Fe サイト同 士が反強磁性的に結合することによって、試料全体 としては O_h 対称 Fe サイトと同じ向きに磁化すると いった可能性が考えられる。現在、この仮説を検証 するための第一原理計算を進めている。

4 <u>まとめ</u>

バルクの反強磁性転移温度(60 K)よりも高いフェ リ磁性転移温度(230 K)を示す Al₂O₃ 基板上 FMO 薄 膜の XMCD 測定を行い、薄膜 FMO の磁気構造に関 する知見を得た。XMCD の磁場依存性から、常磁性 成分はほぼ存在せず強磁性(フェリ磁性)成分が主 であることが明らかになった。また XMCD総和則か ら、軌道磁気モーメントが比較的大きな値を持つこ とが判明した。さらに XMCD の参照スペクトルとの 比較から、この FMO 薄膜では O_h対称性を持つ Fe イ オンが磁場と反平行、T_d対称性を持つ Fe イオンが磁 場と平行に磁化しているようなフェリ磁性となって いることが明らかになった。

参考文献

- [1] Y. Wang et al., Sci. Rep. 5, 12268 (2015).
- [2] T. Kurumaji et al., Phys. Rev. X 5, 031034 (2015).
- [3] H. Czeskleba, P. Imbert, and F. Varret, *AIP Conf. Proc.* 5, 811 (1972).
- [4] 毛司辰ほか,第 80 回応用物理学会 秋季学術講演 会 19p-133-9 (2019).
- [5] M. Furuse *et al.*, *IEEE Trans. Appl. Supercond.* 23, 4100704 (2013).
- [6] G. Shibata et al., npj Quantum Mater. 3, 3 (2018).



図 3: Al₂O₃基板上 FMO 薄膜の XMCD スペクト ルおよび参照スペクトル[11-13]との比較

- [7] 芝田悟朗ほか, Photon Factory Activity Report 2018, 36 (2019).; G. Shibata et al., J. Phys. Chem. C 125, 12929 (2021).
- [8] T. J. Regan et al., Phys. Rev. B 64 214422 (2001).
- [9] B. T. Thole et al., Phys. Rev. Lett. 68, 1943 (1992).
- [10] P. Carra et al., Phys. Rev. Lett. 70, 694 (1993).
- [11] K. Matsuura et al., Phys. Rev. B 92, 035133 (2015)
- [12] Y. K. Wakabayashi et al., Phys. Rev. B 96 104410 (2017).
- [13] C. I. Pearce et al., Am. Mineral. 95, 425 (2010); J. Everett et al. J. R. Soc. Interface 11:20140165 (2014).

成果

1. 芝田悟朗ほか,日本物理学会 2020 年秋季大会 8aE2-5 (2020).

* shibata@rs.tus.ac.jp